

創新技術研究發展產學合作計畫

■ 本局（中科管理局）召開第 3 次創新技術研究發展產學合作計畫獎助審核會議，計有弘榮光罩及聯相光電審查通過

中部科學工業園區管理局於 97 年 6 月 4 日(星期三)，召開第 3 次創新技術研究發展產學合作計畫獎助審核會議，會中共計通過獎助 2 家廠商提出之創新技術研究發展計畫，計畫內容及決議如下：

第一案：弘榮光罩股份有限公司：「大型 TFT LCD 光罩 MURA 圖形處理的製程改善與 MURA 品質預測模組的建立計畫」研發獎助申請案。

光罩係將電腦所設計之電子迴路，利用高精密的雷射或電子束，寫在石英玻璃上。弘榮光罩公司所生產的光罩產品，主要為供應大型平面顯示器製造商，用於大量生產液晶面板的母版。該公司目前生產光罩尺寸達到 58 英吋，可滿足目前最先進的液晶面板廠生產所需。如果光罩本身已有 MURA 現象，則在液晶面板上將造成嚴重的品質問題，因此避免在光罩上產生 MURA，是一個極為重要的技術問題，該公司為克服在光罩上產生 MURA 問題（顯示器亮度不均勻造成的現象，主要是在圖形處理的製程及光罩描繪的製程），由本計畫針對圖形處理製程的研究，從根本的圖形資料處理來降低或避免光罩上 MURA 的產生，提供高品質的光罩給大型平面顯示器製造商。本計畫獲審查委員同意獎助新台幣 250 萬元。

第二案：聯相光電股份有限公司：「銅銦鎵化二硒薄膜太陽能電池之技術開發計畫」研發獎助申請案，該公司薄膜非晶矽太陽能電池已成功量產，目前更致力於高效率銅銦鎵化二硒(CuInGaSe₂)薄膜太陽能電池之研發，其中以混合式濺鍍法製作 CIGS 薄膜電池，同時模擬量產製程中可能遭遇之困難與挑戰，並尋求解決方法，希望能藉本創新開發計畫執行研發 CIGS 太陽能電池製程，加速國內 CIGS 量產技術之建立，相關製程的開發亦有助於國內廠商後續投入高效率薄膜太陽能電池重要關鍵技術。本計畫獲審查委員同意獎助新台幣 500 萬元。